

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分  
 【発行日】平成23年12月15日 (2011.12.15)

【公開番号】特開2010-107840(P2010-107840A)  
 【公開日】平成22年5月13日 (2010.5.13)  
 【年通号数】公開・登録公報2010-019  
 【出願番号】特願2008-281402(P2008-281402)  
 【国際特許分類】

G 0 9 F 9/30 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

G 0 2 F 1/136 (2006.01)

【F I】

G 0 9 F 9/30 3 3 8

H 0 5 B 33/14 A

G 0 2 F 1/136

【手続補正書】

【提出日】平成23年10月31日 (2011.10.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に、複数の画素回路がマトリクス状に配置された表示領域と、制御信号によって導通及び非導通が制御され、前記画素回路に映像信号を供給する複数のスイッチ回路とを有する表示装置であって、

前記複数のスイッチ回路は、互いに隣接して第 1 の方向に配置された薄膜トランジスタによって形成され、

前記薄膜トランジスタは、前記映像信号が供給される前記薄膜トランジスタのソース電極と、前記スイッチ回路を介して当該映像信号を前記画素回路に供給するデータ信号線に接続されたドレイン電極と、前記制御信号が供給されるゲート電極とが前記第 1 の方向とは異なる第 2 の方向に延在して配置され、

前記薄膜トランジスタのソース電極とドレイン電極の 2 つの電極が、前記薄膜トランジスタの活性層にコンタクトホールによって接続され、

前記ソース電極と前記ドレイン電極の少なくとも一方は、前記コンタクトホールが形成された領域の前記第 1 の方向における幅が、前記コンタクトホールが形成されていない領域の前記第 1 の方向における幅より大きく形成されており、

隣接する 2 つのスイッチ回路の前記異なる幅を有して形成されたソース電極またはドレイン電極が、互いの幅が大きく形成された部分と幅が小さく形成された部分とを向い合せ、かつ幅が大きく形成された部分が前記第 2 の方向から見て重なるように配置されていることを特徴とする表示装置。

【請求項 2】

前記薄膜トランジスタの活性層は、ポリシリコンによって形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の表示装置。